

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和6年9月25日(2024.9.25)

【公開番号】特開2024-107448(P2024-107448A)

【公開日】令和6年8月8日(2024.8.8)

【年通号数】公開公報(特許)2024-148

【出願番号】特願2024-96998(P2024-96998)

【国際特許分類】

G 02 F 1/1368(2006.01)

10

G 02 F 1/1343(2006.01)

【F I】

G 02 F 1/1368

G 02 F 1/1343

【手続補正書】

【提出日】令和6年9月13日(2024.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

20

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の上方に形成された第1の電極と、
前記第1の電極の上方に形成された第1の絶縁膜と、
前記第1の絶縁膜の上方に形成された半導体膜と、
前記半導体膜の上方に形成された第2の絶縁膜と、
前記第2の絶縁膜の上方に形成された導電膜と、
前記導電膜の上方に形成された第3の絶縁膜と、
前記第3の絶縁膜の上方に形成され、開口を有する第2の電極と、
前記第2の電極の上方に配置された液晶と、を有し、
前記トランジスタのチャネル形成領域は、シリコンを有する、液晶表示装置。

30

40

50